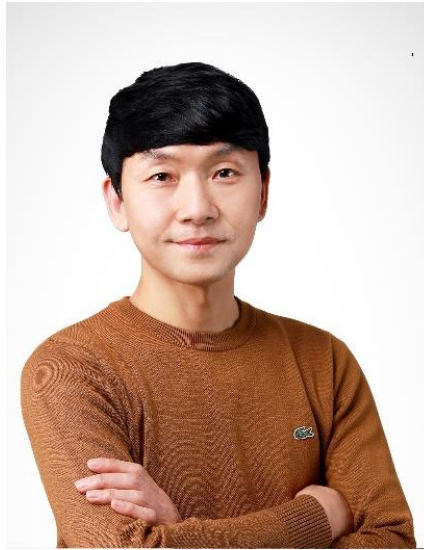


BIOGRAPHY

SPT Tutorial 2026 1st



오재형 TL
SK hynix

Biography

1995년~ SK하이닉스 연구소 Photo장비기술

2004년~ 연구소 MI(Metrology & Inspection)

DRAM/NAND 계측기술 개발 업무 수행

2019년~ 제조/기술 DRAM MI(Metrology & Inspection) 근무 중

반도체 상생협력 MI분과 전문위원 활동 중

Abstract

반도체 회로 패턴이 점점 미세화 되면서 반도체 소자를 형성하기 위한 공정 진행 방법 또한 점점 어려워지고 복잡해지고 있다. 특히 반도체 제품의 Pattern Shrinkage, SPT/DPT 공정의 확대, 구조 변화 등에 따라 다양한 형태의 불량들이 발생할 뿐만 아니라 불량 Size 또한 더욱더 작아지고 있어 제조 공정 과정에서 발생하는 문제점을 빠르고 정확하게 확인 할 수 있는 In-line 계측 기술에 대한 요구가 높아지고 있다. 본 강의에서는 반도체 제조 공정 과정에서 사용되는 Metrology & Inspection 분야의 중요 장치들의 기본적인 작동 원리와 종류를 알아보고, 각 장비들의 활용 사례를 통하여 공정상의 문제점 파악과 해결 방법들을 살펴보고, 향후 신제품 대응에 필요한 차세대 Metrology & Inspection Tools의 개발 Trend에 대해서 다루고자 한다.